2Da06

フタロシアニンエピタキシャル膜の

極低温 STM 観察

(¹総研大、²分子研、³JST-CREST) ○高田 正基¹・多田 博一^{1,2,3}

[序] STM を用いた原子スケールの表面研究の発展に伴い、金属表面に吸着した分子の 単一分子レベルでの観察が盛んに行われてきた[1]。そこでは基板表面と孤立吸着分子、も しくは単分子層の相互作用は報告されているが、多層膜での分子間相互作用の報告例は ほとんどない。今回我々は、フタロシアニンエピタキシャル膜を作製し、2 層目以降の電子状 態変化を、極低温 STM による表面形状像と共に局所状態密度を観察して調べた。

[方法] マイカ基板上に Au(111)薄膜を作製し、これをスパッタリングとアニーリングによって 清浄化した。分子としてコバルトフタロシアニン分子(CoPc)を用い、これを Au(111)表面上に 超高真空中で数分子層蒸着した。この試料を 78K に冷却し STM 観察を行った。探針として Pt/Ir ワイヤーを使用した。

[結果] 図1は CoPc 数分子膜の STM 像である。CoPc 分子が Au(111)表面全面を覆って おり、矩形の晶癖を持つ層状グレインが確認できる。A 部分は、STM 像にバイアス依存がな いことや以前の報告などから、Au(111)表面上の CoPc 単分子膜であることを確認した[2]。 Au(111)表面は六方晶のファセットを形成し、長方形のグレインは形成しない。したがって図 1 中 B のグレインは、CoPc 第2層目と考えられる。

図2(a)は、2 層目と1 層目を観察した STM 像である。図 2(b)には XY 線での断面プロフ アイルを示した。この図より2 層目 CoPc 分子 は1 層目 CoPc 直上に配置し、2 層目 CoPc 分子の面内回転方向は、1 層目と同じ配置で



図1. CoPc多層膜のSTM像 (V=-1.2V, It=35pA、 破線はAuの単原子ステップ位置を表す)



図2. (a) 第1層目と第2層目のCoPc薄膜のSTM 像 (V =−1.0V, I=100pA)。 (b) (a)のAB線の断 面図。矢印はCo金属の位置を示す。

あることがわかる。図 2(b)中で、破線は 2 層目 CoPc の分子平面を表している。これより 2 層 目 CoPc は表面より 2.6°傾いていることがわかった。図 2(a)の AB 線に対し 90°の方向で は、このような分子の傾きは見られなかった。

図1中でCと示されているように、CoPc第2層目上に少数個のCoPc分子の集合体が確認された。これは第3層目と考えられる。図3(a)は第2層目と第3層目のSTM像である。 図の中央に4個のCoPc分子が3層目として吸着している。3層目の吸着構造は、1層目 CoPcに対する2層目CoPcの構造と同様に、2層目CoPc直上に3層目CoPcが位置し、 面内の回転方向も2層目と同じであった。図3(b)は図3(a)のAB線の断面図であり、図中の 破線は3層目CoPcの分子平面を表している。これより3層目のCoPc分子は表面より4.0° 傾いており、2層目CoPcの傾きより増加していることがわかった。

図3(a)では中心金属 Coは凹になっているが、サンプルバイアス(V)を変化させると、図3(c) のように中心金属の Co の凹凸が変化するのが確認された。従来報告されている金属表面 上の第1層目の CoPc 分子では Co 金属は凸で、バイアス依存性は確認されていない[2]。 多層膜の分子-分子間相互作用は第1層の金属-分子間の相互作用より弱いため、多層膜 の分子の準位は第1層目に比べ局在化し、バイアス依存が顕著になったと考えられる。局 所電子状態像やその膜厚依存性、分子軌道計算による電子状態との比較も同時に報告す る。

[1] 例えば、P. H. Lippel, et al, Phys. Rev. Lett. 62, 171(1989); S. Chiang, Chem. Rev. 97, 1083(1997); X. Lu, et al, Phys. Rev. Lett. 90, 096802-1(2003). [2] K. W. Hipps, et al. J. Phys. Chem. 100, 11207(1996).





図3. (a) 第2層目と第3層目のCoPc薄膜のSTM像(=-1.1V, I=70pA)。 b) 図3 (a)のAB線の断面図。矢印はCo金属の位置を示す。 (c) (a)の異なる電圧でのSTM 像 (V=2.2V, I=70pA)。